



KINTEK SOLUTION

## Pavd Catalogar

Contáctenos para más catálogos de Preparación de la muestra, Equipo Térmico, Materiales y consumibles de laboratorio, Equipos de bioquímica, etc...

# KINTEK SOLUTION

## PERFIL DE LA EMPRESA

### >>> Sobre nosotros

Kintek Solution Ltd es una organización orientada a la tecnología, los miembros del equipo se dedican a probar la tecnología y las innovaciones más eficientes y confiables en los equipos de investigación científica, campos como la reacción bioquímica, la investigación de nuevos materiales, el tratamiento térmico, la creación de vacío, la refrigeración y la industria farmacéutica. y equipos de extracción de petróleo.

En los últimos 20 años, obtuvimos ricas experiencias en este campo de equipos de investigación, somos capaces de suministrar tanto el equipo como la solución de acuerdo con las necesidades y realidades del cliente, también hemos desarrollado muchos equipos de cola del cliente de acuerdo con un propósito de trabajo específico, y Tenemos muchos proyectos exitosos en muchas universidades e institutos de diferentes países, como Asia, Europa, América del Norte y del Sur, Australia y Nueva Zelanda, Medio Oriente y África.

Profesión, respuesta rápida, trabajo duro y sinceridad es una etiqueta notable de la actitud de trabajo de los miembros de nuestro equipo, lo que nos hace ganar una sólida reputación entre nuestros clientes.

¡Estamos aquí y listos para servir a nuestros clientes de diferentes países y regiones, y compartir juntos la tecnología más eficiente y confiable!



# Sistema Slide Pecvd Con Gasificador Líquido

Número de artículo: KT-PE12



## Introduction

Sistema KT-PE12 Slide PECVD: amplio rango de potencia, control de temperatura programable, calentamiento/enfriamiento rápido con sistema deslizante, control de flujo másico MFC y bomba de vacío.

[Aprende más](#)

Modelo de horno	KT-PE12-60
máx. temperatura	1200°C
Temperatura de trabajo constante	1100°C
Material del tubo del horno	cuarzo de alta pureza
Diámetro del tubo del horno	60 mm
Longitud de la zona de calentamiento	1x450mm
Material de la cámara	Fibra de alúmina de Japón
Elemento de calefacción	Bobina de alambre Cr2Al2Mo2
Velocidad de calentamiento	0-20 °C/minuto
Pareja térmica	Construir en tipo K
Controlador de temperatura	Controlador PID digital/Controlador PID de pantalla táctil
Precisión del control de temperatura	±1°C
Distancia de deslizamiento	600 mm
Unidad de plasma RF	
Potencia de salida	5 -500W ajustable con ± 1% de estabilidad
frecuencia de radiofrecuencia	13,56 MHz ±0,005 % de estabilidad
Poder de reflexión	350 W máx.
Pareo	Automático
Ruido	
Enfriamiento	Aire acondicionado.
Unidad de control de precisión de gas	
Medidor de corriente	Medidor de flujo másico MFC
Canales de gas	4 canales
Tasa de flujo	MFC1: 0-5 SCCM O2 MFC2: 0-20SCMCH4 MFC3: 0- 100 SCCM H2 MFC4: 0-500 SCCM N2
linealidad	±0,5 % fondo de escala

Repetibilidad	±0,2 % fondo de escala
Tubería y válvula	Acero inoxidable
Presión máxima de funcionamiento	0.45MPa
Controlador de medidor de flujo	Controlador de perilla digital/controlador de pantalla táctil
Unidad de vacío estándar (Opcional)	
Bomba aspiradora	Bomba de vacío de paletas rotativas
Caudal de la bomba	4L/S
Puerto de succión de vacío	KF25
Indicador de vacío	Vacuómetro Pirani/Resistencia de silicio
Presión de vacío nominal	10Pa
Unidad de alto vacío (Opcional)	
Bomba aspiradora	Bomba rotativa de paletas+bomba molecular
Caudal de la bomba	4L/S+110L/S
Puerto de succión de vacío	KF25
Indicador de vacío	Vacuómetro compuesto
Presión de vacío nominal	6x10 <sup>-5</sup> Pa

Las especificaciones y configuraciones anteriores se pueden personalizar

No.	Descripción	Cantidad
1	Horno	1
2	tubo de cuarzo	1
3	Brida de vacío	2
4	Bloque térmico de tubo	2
5	Gancho de bloque térmico de tubo	1
6	Guante resistente al calor	1
7	fuelle de plasma de radiofrecuencia	1
8	Control preciso de gases	1
9	Unidad de vacío	1
10	Operación manual	1

# Horno De Deposición Química Mejorada Con Plasma Rotativo Inclinado (Pecvd)

Número de artículo: KT-PE16



## Introduction

Presentamos nuestro horno PECVD giratorio inclinado para la deposición precisa de películas delgadas. Disfrute de una fuente de coincidencia automática, control de temperatura programable PID y control de caudalímetro másico MFC de alta precisión. Características de seguridad integradas para su tranquilidad.

[Aprende más](#)

Modelo de horno	PE-1600-60
máx. temperatura	1600°C
Temperatura de trabajo constante	1550°C
Material del tubo del horno	Tubo Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> de alta pureza
Diámetro del tubo del horno	60 mm
Longitud de la zona de calentamiento	2x300mm
Material de la cámara	Fibra de alúmina de Japón
Elemento de calefacción	Disilicida de molibdeno
Velocidad de calentamiento	0-10 °C/minuto
Pareja térmica	tipo B
Controlador de temperatura	Controlador PID digital/Controlador PID de pantalla táctil
Precisión del control de temperatura	±1°C
Unidad de plasma RF	
Potencia de salida	5 -500W ajustable con ± 1% de estabilidad
frecuencia de radiofrecuencia	13,56 MHz ±0,005 % de estabilidad
Poder de reflexión	350 W máx.
Pareo	Automático
Ruido	
Enfriamiento	Aire acondicionado.
Unidad de control de precisión de gas	
Medidor de corriente	Medidor de flujo másico MFC
Canales de gas	4 canales
Tasa de flujo	MFC1: 0-5 SCCM O <sub>2</sub> MFC2: 0-20SCMCH <sub>4</sub> MFC3: 0- 100 SCCM H <sub>2</sub> MFC4: 0-500 SCCM N <sub>2</sub>

linealidad	±0,5 % fondo de escala
Repetibilidad	±0,2 % fondo de escala
Tubería y válvula	Acero inoxidable
Presión máxima de funcionamiento	0.45MPa
Controlador de medidor de flujo	Controlador de perilla digital/controlador de pantalla táctil
Unidad de vacío estándar (Opcional)	
Bomba aspiradora	Bomba de vacío de paletas rotativas
Caudal de la bomba	4L/S
Puerto de succión de vacío	KF25
Indicador de vacío	Vacuómetro Pirani/Resistencia de silicio
Presión de vacío nominal	10Pa
Unidad de alto vacío (Opcional)	
Bomba aspiradora	Bomba rotativa de paletas+bomba molecular
Caudal de la bomba	4L/S+110L/S
Puerto de succión de vacío	KF25
Indicador de vacío	Vacuómetro compuesto
Presión de vacío nominal	6x10-5Pa
Las especificaciones y configuraciones anteriores se pueden personalizar	

No.	Descripción	Cantidad
1	Horno	1
2	tubo de cuarzo	1
3	Brida de vacío	2
4	Bloque térmico de tubo	2
5	Gancho de bloque térmico de tubo	1
6	Guante resistente al calor	1
7	fuelle de plasma de radiofrecuencia	1
8	Control preciso de gases	1
9	Unidad de vacío	1
10	Operación manual	1

# Deposición Por Evaporación Mejorada Con Plasma Máquina De Revestimiento Pecvd

Número de artículo: KT-PED



## Introduction

Actualice su proceso de recubrimiento con equipos de recubrimiento PECVD. Ideal para LED, semiconductores de potencia, MEMS y mucho más. Deposita películas sólidas de alta calidad a bajas temperaturas.

[Aprende más](#)

Soporte de muestras	Tamaño	1-6 pulgadas
	Velocidad de rotación	0-20rpm ajustable
	Temperatura de calentamiento	≤800°C
	Precisión de control	±0,5°C Controlador PID SHIMADEN
Purga de gas	Medidor de caudal	CONTROLADOR DE CAUDALÍMETRO MÁSIKO (MFC)
	Canales	4 canales
	Método de refrigeración	Refrigeración por agua circulante
Cámara de vacío	Tamaño de la cámara	Φ500mm X 550mm
	Puerto de observación	Puerto de visión completa con deflector
	Material de la cámara	Acero inoxidable 316
	Tipo de puerta	Puerta de apertura frontal
	Material de la tapa	Acero inoxidable 304
	Puerto de la bomba de vacío	Brida CF200
	Puerto de entrada de gas	φ6 Conector VCR
Potencia de plasma	Fuente de alimentación	Alimentación CC o RF
	Modo de acoplamiento	Acoplado inductivamente o capacitivo de placa
	Potencia de salida	500W-1000W
	Potencia de polarización	500v
Bomba de vacío	Prebomba	Bomba de vacío de paletas 15L/S
	Puerto de la bomba turbo	CF150/CF200 620L/S-1600L/S
	Puerto de alivio	KF25
	Velocidad de la bomba	Bomba de paletas:15l/s[Bomba turbo:1200l/s]1600l/s
	Grado de vacío	≤5×10-5Pa
	Sensor de vacío	Medidor de vacío de ionización/resistencia/medidor de película
Sistema	Alimentación eléctrica	CA 220V /380 50Hz

Potencia nominal	5kW
Dimensiones	900mm X 820mm X870mm
Peso	200kg





## Kintek Solution

Cuartel general: No.11 Changchun Road, Zhengzhou, China

Oficina de Hong Kong: 300 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong

Oficina de Canadá: Boulevard Graham, Mont-Royal, QC, H3P 2C7, Canadá

